実験ステーション(専用ビームライン)

BL24XU 兵庫県

1.はじめに

兵庫県ビームラインは、ダイヤモンド結晶を分岐・分光 素子に用いたトロイカ方式を採用し、3つの異なるハッチ で同時に実験することが可能である。このビームラインで は、蛋白質結晶の構造解析、金属材料の表面/界面分析、 in-situ MOCVD表面X線回折実験およびX線マイクロ ビーム形成とその応用実験が行われている。ここでは、 2001年度に行われたX線顕微鏡の開発および高平行度X 線マイクロビームの改良について述べる。

2 . X 線位相差顕微法

2 1 ゼルニケ法による X 線位相差顕微鏡

位相ゾーンプレートを X 線レンズに用いたゼルニケ法 による X 線位相差顕微鏡の開発を進めており、透明試料の 可視化に成功している^[1]。 X 線のエネルギーを位相板の材 料である金の L₃吸収端近傍に合わせることにより(12keV) 位相差コントラストの向上を試みた。図1はポリスチレン 粒子(直径 7 µm)を観察した例である。吸収コントラスト では輪郭がかすかに見える程度なのに対し、位相コントラ ストではポリスチレンの粒子構造が明瞭に観察できた。さ らにポジティブコントラストとネガティブコントラストで は像のコントラストが反転することも確認できた。



図1 ポリスチレン粒子(直径7µm)のX線顕微鏡 像(a)吸収コントラスト像、(b)ポジティブコン トラスト像、(c)ネガティブコントラスト像ス ケールバーは10µm

22 走查型顕微鏡

位相ゾーンプレートを集光素子に用いた、走査型顕微鏡 の開発とその応用研究を進めている。これまでは入射光の エネルギーを10keV としていたが、励起可能な元素の種類 を増やすために、入射光の高エネルギー化を試みた。その 結果、20keV においても位相ゾーンプレートは十分に集光 作用を持ち、バックグランドの低い良質なマイクロビーム を形成することができた。表1に入射光のエネルギーとマ イクロビームの性能を示す。ゾーンプレートの焦点距離は

表1 入射X線のエネルギーとマイクロビームの性能比較	え表
----------------------------	----

エネルギー	ビームサイズ(µm)	フォトンフラックス(photons/s/100mA)
10keV	0.7(V)×1.1(H)	約1×10 ⁹
20keV	1.3(V)×3.1(H)	約 8 × 10 ⁸

エネルギーに比例して長くなり、また20keV での回折効率 は10keV の約4/5なので、得られた結果はほぼ予測通りで ある。

3. 高平行度 X線マイクロビーム

半導体結晶の局所的な結晶歪み評価には、角度発散角が 小さくエネルギーバンド幅の小さい X 線マイクロビーム が必要である。これまで、Si 結晶の逆非対称反射を利用し て高平行 X 線マイクロビームを形成してきたが[2]、この手 法では 5 m以下のマイクロビームを形成するのは非常に困 難である。そこで、今回結晶と X 線全反射ミラーを組み合 わせた光学系を新たに開発した。その光学系を図2に示す。 実験ハッチに導入された X 線はまずスリットにより水平 方向 5 µm、鉛直方向100µmに整形される。その後、(+、-、 - 、 +) に配置された 2 つの Si チャンネルカットの333反 射により、エネルギー分散を E/E = 1 × 10⁻⁵まで制限し、 ベントシリンドリカルミラーによりサンプル上に集光され る。これにより得られたビームのサイズは水平方向2.6um、 鉛直方向1.6µm、水平方向の角度発散角は25µrad、X線強度 は1 × 10⁶であった。このビームにより、微小領域におけ る格子ひずみを、 d/d~1×10⁻⁶程度の感度で検出する ことが可能である。

姫路工業大学



松井 純爾・篭島 靖・津坂 佳幸

参考文献

- [1]津坂他: The 5th SPring-8 Symposium Abstract(2001) 57.
- [2] Y.Tsusaka et al .: Jpn .J .Appl .Phys .39(2000)L635